



2026年3月10日

各位

会社名 J X金属株式会社  
代表者名 代表取締役社長 林 陽一  
(コード: 5016、東証プライム)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部 米山 学  
開示担当課長  
(TEL. 03-6433-6088)

## ひたちなか新工場における半導体用スパッタリングターゲットの増産に向けた 設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ

J X金属株式会社（社長、林 陽一、以下「当社」）は、AI データセンター向けを中心に需要が急増している半導体用スパッタリングターゲットの生産能力を強化するため、本日、ひたちなか新工場（茨城県ひたちなか市）内における増産投資を実施することを決定いたしました。投資額は約 230 億円を予定しております。

### 1. 理由

当社は、2022 年、茨城県ひたちなか市に大規模用地を取得し、半導体分野をはじめとしてこれからのデジタル社会の進展に不可欠な先端材料の新たな中核拠点とするべく、ひたちなか新工場の建設工事を進めてまいりました。昨年 7 月には先行してリサイクル物流センターの稼働を開始しており、本年 3 月末には半導体用スパッタリングターゲットの一部の生産設備の試運転を開始し、開業を迎える予定としております。

半導体材料の製造設備については、マーケット動向を見据えながら適宜機動的に増強を図ることとしておりましたが、足元、AI データセンター用途における先端ロジック半導体や先端メモリ半導体（HBM 等）の需要が拡大しており、これら先端半導体に必要となる当社の半導体用スパッタリングターゲットの急速な需要の拡大が見込まれることから、このタイミングで生産能力を拡充することが必要であると判断しました。今回の能力増強によって、今後の需要拡大に応えられる安定供給体制を構築するとともに、世界の先端半導体サプライチェーンにおけるプレゼンスをより一層強化してまいります。また、設備の導入に際しては、既存の半導体用スパッタリングターゲット生産の中核拠点である磯原工場で培った技術・ノウハウを活用し、より効率的な生産ラインの構築を行う予定です。

### 2. 設備投資の概要

#### (1) 内容

ひたちなか薄膜材料工場（茨城県ひたちなか市）に、半導体用スパッタリングターゲットの製造設備一式を増強

(2) 投資額 約 230 億円

※2024年3月6日付プレスリリース「[ひたちなか新工場（仮称）投資計画の一部変更について](#)」で公表したひたちなか新工場への投資額「1,500億円」の内数であり、2025年7月18日付開示文書「[補助金対象経済産業省による半導体用スパッタリングターゲットに係る供給確保計画の認定について](#)」で公表した66億円の投資を含む。

(3) 生産能力

2023年度比 1.6倍

(4) 稼働開始

2027年度下期より順次稼働（予定）

3. 今後の見通し

2026年3月期連結業績への影響は軽微です。

以 上